

DRAM における洗浄技術の開発課題

Development subjects of cleaning technology for DRAM

マイクロメモリジャパン合同会社, °八木 秀明

Micron Memory Japan, G.K., °Hideaki Yagi

E-mail: hyagi@micron.com

DRAM 開発においては、スケーリング要求に対応する各種プロセス技術の進展が、高集積化とともに高性能・低消費電力の DRAM を実現してきた。次世代 DRAM の開発・製品化と歩留向上に向け、一層の微小異物対策や、高アスペクトで脆弱な構造に対する高度な洗浄・乾燥技術が必要とされる。本講演ではこれらの課題について概観する。